

PVD电镀哪里近 PVD电镀 瑞泓科技公司

产品名称	PVD电镀哪里近 PVD电镀 瑞泓科技公司
公司名称	深圳市瑞泓科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路47号A栋405
联系电话	13410735785

产品详情

PVD镀膜的具体原理是什么？

答:物理气相沉积是一种物理气相反应生长法，沉积过程是在真空或低气气体放电条件下，涂层物质源是固态物质，经过“蒸发或溅射”后，在零件表面生成与基材性能完全不同的新的固态物质涂层。

PVD镀膜与传统的化学电镀（水电镀）相比有何优点？

PVD镀膜与传统的化学电镀的相同点是，两者都属于表面处理的范畴，都是通过一定的方式使一种材料覆盖在另一种材料的表面。

镀金属膜层，将待镀产品传入装有金属靶材的镀膜腔室，开启泵抽真空及加热装置进行基底加热，使得本底真空达到 1×10^{-3} Pa 及达到80-150 工艺温度后，向腔室通入10-1000sccm的ya气，启动溅射电源，设置溅射功率1-15KW，镀膜时间10-300S，得到厚度为1-100nm的金属膜层，金属膜层为铜(Cu)、银(Ag)、铝(Al)、铬(Cr)等金属膜层，或镍铜(NiCu)、镍铬(NiCr)等合金膜层;

镀低折射率膜层，将镀完金属膜层的产品传入装有可形成低折射率膜层的靶材镀膜腔室，PVD电镀，加热达到80-150 的工艺温度，向腔室通入工艺气体，PVD电镀表面处理，设置溅射功率1-15KW，镀膜时间1-300S，得到厚度为1-100nm的低折射率膜层，此低折射率膜层为氧化硅、氮化硅等膜层;

PVD（技术是制备薄膜材料的主要技术之一，在真空条件下采用物理方法，将某种材料气化成气态原子、分子或部分电离成离子，并通过低压气体（或等离子体）过程，在基板材料表面沉积具有增透、反射、保护导电、导磁、绝缘、耐腐蚀、防辐射、装饰等特殊功能的薄膜材料的技术。用于制备薄膜材料的物质被称为 PVD镀膜材料。溅射镀膜和真空蒸发镀膜是主流的两种 PVD 镀膜方式。

以不锈钢钛金举例，大致了解一下PVD技术。不锈钢工件清洗干净后进入真空罐，抽真空到 10^{-3} Pa这个级别，再通入氮气到0.1-1.0Pa，钛金属放电通过等离子化的氮气，PVD电镀哪里近，沉积到（负偏压）的工件上。沉积物是金色的氮化钛（TiN）。

这种装饰性镀膜，厚度一般都是低于1微米，别想着性能有多少好。当然了，如果有几个微米厚度，那硬度就OK了，可以胜任切削刀具的镀膜。

真空镀膜材料工艺流程

原料粉末——配料——混料——原料预处理——成型——预烧——真空烧结——分拣——真空包装

PVD电镀哪里近-PVD电镀-瑞泓科技公司由深圳市瑞泓科技有限公司提供。深圳市瑞泓科技有限公司是从事“铝合金电镀,铝合金真空镀膜,铝合金真空钛金”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨小姐。